

高功率激光与光学

软X射线投影光刻技术

[金春水](#) [王占山](#) [曹健林](#)

(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室, 长春 130022)

摘要: 软X射线投影光刻作为特征线宽小于 $0.1\mu\text{m}$ 的集成电路制造技术, 倍受日美两个集成电路制造设备生产大国重视。近年来, 在软X射线投影光刻用无污染激光等离子光源、高分辨率大视场投影光学系统、无应力光学装调工艺、深亚纳米级镜面加工和多层膜制备、低缺陷反射式掩模、表面成像光刻胶、精密扫描机构等关键技术均取得了突破。

关键词: [软X射线](#) [投影光刻](#) [集成电路](#)

通信作者:

相关文章([软X射线](#)):

[类钠铜离子软X射线激光三体复合泵浦机制的研究](#)

[一种长狭缝软X射线扫描相机系统](#)

[HIREFS谱仪在类氩钛软X射线激光中的应用](#)

[高通滤波法数字重现同轴全息图](#)

[可变入射距离平焦场谱仪的概念设计](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)